



Малогабаритная вакуумная установка магнетронного напыления настольного типа МВУ ТМ-Магна Т



Назначение:

Нанесение плёнок металлов (Cu, Cr, Al, и др.) и диэлектриков (SiO₂, Si₃N₄, др.) методом магнетронного распыления.

Особенности:

- Групповая обработка пластин:
 - 60x48 мм - 6шт. -двухсторонняя обработка.
 - Ø 150 мм - 2шт. } -односторонняя обработка.
 - Ø 60, 76, 100 мм - 4шт. }
- Откачка реактора до предельного разряжения $5 \cdot 10^{-4}$ Па;
- Подготовка поверхности подложек – нагрев и ВЧ ионная очистка.
- Автоматизированное управление от микропроцессора.
- Малогабаритная безмасляная вакуумная система откачки.
- Автономная система водяного охлаждения.
- Потребляемая мощность не более 5,5 кВт.
- Площадь, занимаемая одной установкой ~1,5 м².
- Возможны комбинации нескольких источников на одной рабочей камере.

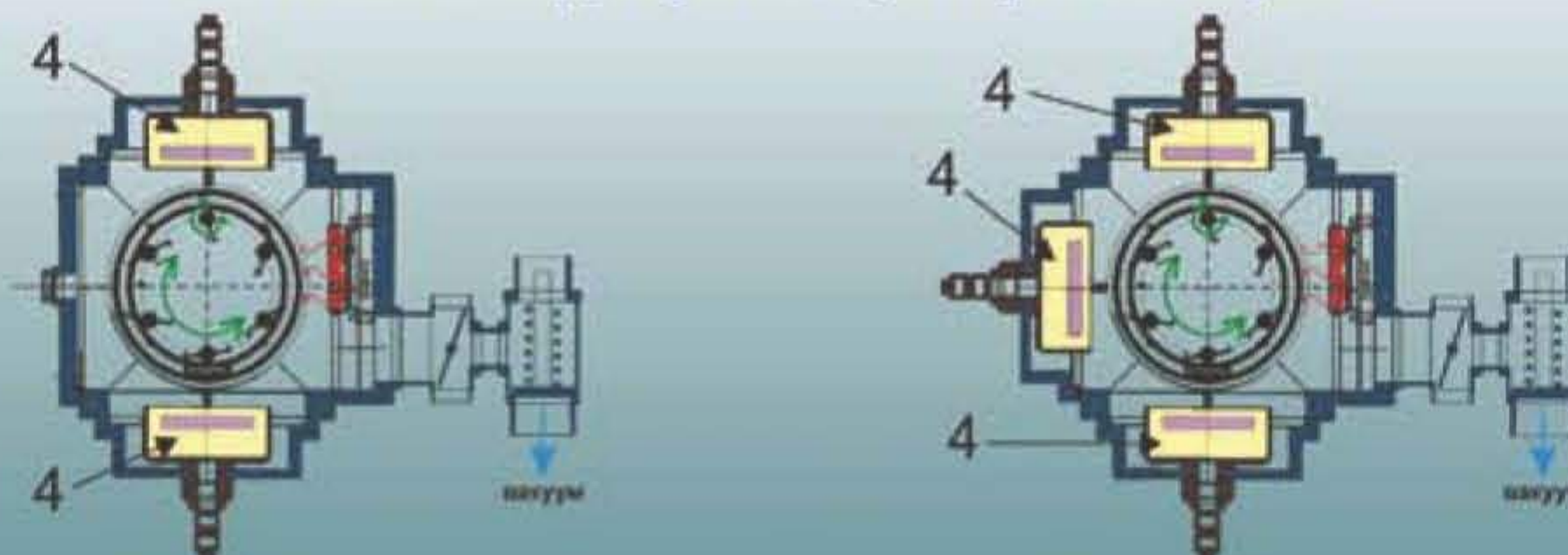
Системы установки:

- Рабочая камера (1);
- Планетарный подложкодержатель (2);
- Вращающийся экран - цилиндрическая заслонка (3);
- Магнетронное распылительное устройство (магнетрон) (4), в том числе распыляемая мишень (5);
- Источник питания магнетрона;
- Система нагрева и ВЧ ионной очистки (6);
- Вакуумная система на базе турбомолекулярного и форвакуумного насосов, в том числе дроссельная заслонка (7), клапан (8);
- Газовая система – включает электронный регулятор расхода газа, ручной запорный кран, регулятор давления, манометр, электромагнитный клапан;
- Система водяного охлаждения;
- Микропроцессорная система управления.

Схема реактора



Схемы модификаций реакторов



МВУ ТМ-Магна Т x 2

МВУ ТМ-Магна Т x 3